



ÉCOLE
CENTRALE LYON

ANNEALSYS

INVITATION PRESSE REGIONALE | LYON-ÉCULLY | DIFFUSÉE LE 14 OCTOBRE 2014

Inauguration du LabCom InCVD : vers de meilleurs procédés pour des matériaux fonctionnels

La société ANNEALSYS, spécialiste en procédés thermiques rapides et dépôts chimiques en phase vapeur, et l'Institut des Nanotechnologies de Lyon (INL, ECL / CNRS / INSA de Lyon / Lyon 1 / CPE Lyon) inaugurent le 24 octobre 2014 leur laboratoire commun. Nommé InCVD¹, il est dédié à la recherche et à l'innovation dans le domaine des procédés de dépôt chimique en phase vapeur et des matériaux associés. Ces procédés permettent de créer des couches minces utilisées notamment en nanoélectronique mais aussi dans de nombreux autres champs d'application. Lauréat de l'appel à projets ANR LabCom destiné à soutenir des partenariats recherche publique - entreprise, l'InCVD est installé sur le site de l'INL à l'Ecole Centrale de Lyon.

Parmi les technologies commercialisées par la société ANNEALSYS, l'une d'entre elles est une méthode particulièrement intéressante pour bon nombre d'applications industrielles : le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) avec une source liquide à injection directe, une technologie issue d'un brevet CNRS déposé en 1993, depuis améliorée par une filiale d'ANNEALSYS. La CVD permet de réaliser des dépôts sur de petites ou grandes surfaces, sur des surfaces complexes, en couche ultramince ou épaisse ; elle permet, de plus, de faire varier de façon très versatile la composition ou le dopage des couches. Enfin, grâce à l'injection séquentielle, elle permet de superposer plusieurs matériaux sur un même substrat sous forme de multicouches. De nombreuses fonctionnalités peuvent être créées. A titre d'exemple, de tels procédés permettent de fabriquer des couches minces isolantes électriques de composés maintenant présents dans les nouvelles générations de transistors, des résistances dotées de « mémoire » (memristors) pour la réalisation de synapses électroniques, des films ferroélectriques pour la réalisation de nouveaux dispositifs logiques ou encore des fils de taille nanométrique : autant de composants que les technologies en cours d'évolution rendent nécessaires, tant dans le domaine de la nanoélectronique que dans celui de l'énergie.



VISITE PRESSE

Le vendredi 24 octobre de 10h à 12h30

Ecole Centrale de Lyon

36 avenue Guy de Collongue – 69130 Ecully

- accueil café dans le hall de l'amphi 3
- visite au sein de la délégation officielle
- présentation publique en amphithéâtre
- cocktail

Accréditation auprès de

communication@dr7.cnrs.fr avant le 20 octobre

¹ InCVD : Innovation en CVD (« chemical vapor deposition », soit « dépôt chimique en phase vapeur »)



www.cnrs.fr



ÉCOLE
CENTRALE LYON **ANNEALSYS**

L'Institut des Nanotechnologie de Lyon (INL, ECL / CNRS / INSA de Lyon / Lyon 1 / CPE Lyon) dispose d'une équipe experte dans le domaine des procédés CVD, capable de les améliorer, de caractériser finement les matériaux élaborés afin d'en étudier leurs propriétés et d'analyser leur potentiel. Le laboratoire prévoit également d'étudier l'intégration des nouveaux matériaux ainsi créés dans des composants de démonstration. Dans le cadre de ces recherches, ANNEALSYS partage avec l'INL un équipement de dépôt chimique en phase vapeur, installé dans les locaux de l'Ecole Centrale de Lyon (ECL). Le CNRS et ANNEALSYS mobilisent du personnel autour de ce projet, constituant ainsi un « laboratoire commun ». Une ingénieure de recherche dédiée à ce projet a été embauchée jusqu'en octobre 2016.

Ce laboratoire est financé à hauteur de 300k€ sur trois ans dans le cadre de l'appel à projet « laboratoires communs » (LabCom) de l'Agence nationale de la recherche. Ce programme a pour objectif de soutenir les acteurs de la recherche publique dans un partenariat bilatéral structuré avec une PME ou une ETI. A terme, 100 laboratoires communs sont prévus dans le cadre des « 15 mesures pour une nouvelle dynamique de transfert de la recherche publique » annoncées par la secrétaire d'état à l'enseignement supérieur et la recherche en novembre 2012.

Contacts

Chercheur :

Catherine Dubourdieu | Directrice InCVD | T 04 72 18 60 52 | catherine.dubourdieu@ec-lyon.fr

Jean-Manuel Decams | Directeur adjoint InCVD | T 04 67 20 23 63 | jmdecams@annealsys.com

Presse :

CNRS Rhône Auvergne | Sébastien Buthion | T 06 88 61 88 96 | communication@dr7.cnrs.fr

Ecole Centrale de Lyon | Catherine Giraud-Mainand | T 04 72 18 63 76 | catherine.giraud-mainand@ec-lyon.fr

TBWA\CORPORATE | Léa Manuel | T 04 37 47 36 29 | lea.manuel@twa-corporate.com